@{3754/24}R)-@{3754/24}-)-4-CYANO-3-HYDROXYLACTIC ACID t-BUTYL ESTER AND ITS PRODUCTION

Patent number:

JP5331128

Publication date:

1993-12-14

Inventor:

MIHASHI SHIGERU others: 02

Applicant:

TAKASAGO INTERNATL CORP

Classification:

- international:

C07C255/20; C07C253/14

- european:

Application number:

JP19920165496 19920602

Priority number(s):

Report a data error hei

Also published as:

园 EP0573184 (A

国 EP0573184 (B

Abstract of JP5331128

PURPOSE:To provide a method for producing (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxylatic acid t-but ester useful as an intermediate for medicines in high optical purity using (S)-(-)-4-halogeno-3-hydroxylactic acid t-butyl ester readily available from diketene as a raw material.

CONSTITUTION:A compound of formula I (Bu-t is t-butyl; X is CI or Br) is dissolved in an aprotic polar solvent and an aqueous solution of a cyanide of the formula MCN (M is Na or K) is added to the solution and the compound of formula I is made to react with the cyanide of the formula MCN at 15-100 deg.C, preferably 40-70 deg.C for 2-3hr whil stirring. Then, the reaction liquid is extracted with an organic solvent such as ethyl acetate, toluene, diisopropyl ether or methylene chloride and then washed with water and the solvent is distilled off and the resultant residue is recrystallized with toluene, ethyl acetate, ethanol, etc., to obtain (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxylactic acid t-butyl ester o formula II. The compound of formula I is obtained by subjecting 4-halogenoacetoacetic acid t-butyl ester obtained from diketene to asymmetric hydrogenation reaction.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平5-331128

(43)公開日 平成5年(1993)12月14日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 7 C 255/20

253/14

6917-4H

6917-4H

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特顏平4-165496

(71)出願人 000169466

高砂香料工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番22号

(22)出願日

平成4年(1992)6月2日

(72)発明者 三橋 茂

東京都大田区蒲田5丁目36番31号 高砂香

料工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 桜井 和俊

東京都大田区蒲田5丁目36番31号 高砂香

料工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 雲林 秀徳

東京都大田区蒲田5丁目36番31号 高砂香

料工業株式会社総合研究所内

(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外2名)

(54) 【発明の名称】

(R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキシ酪酸 t - プチルエステル及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 光学純度99%ee以上の(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 t-プチルエステルを 提供する。

【構成】 4-ハロゲノアセト酢酸 t-プチルエステル に不斉水素化反応を行い、生成した(S)-(-)-4 - ハロゲノ - 3 - ヒドロキシ酪酸 t - プチルエステルに シアノ化反応を行い再結晶して高光学純度の光学活性体 として分離することにより前記目的化合物を得る。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)

【化1】

(式中 B u − t は t −プチル基を示す。)で表される (R)−(−)−4−シアノ−3−ヒドロキシ酪酸 t − プチルエステル。

【請求項2】 一般式(2)

【化2】

 (式中Xは塩素原子又は臭素原子を示し、Bu-tはt-ブチル基を示す。)で表される化合物に一般式(3)

 【化3】MCN
 (3)

(式中Mはナトリウム原子又はカリウム原子を示す。) で表されるシアン化物を反応せしめることを特徴とする 請求項1記載の化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医薬中間体として有用な、(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 tープチルエステルに関し、この化合物は種々の医薬品中間体として多くの化合物へと導くことができる。例えば、3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル補酵素 A (以下HMG-CoAと略記する。) 還元酵素の阻害剤の活性部位と考えられているラクトン部位である4-ヒドロキシ-3,4,5,6-テトラヒドロ-2H-ピラ 30 ン-2-オンへと導くことができる。

[0002]

【従来の技術】(R) - (-) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エステル類は、コレステロール低下剤、HMG-CoA還元酵素の阻害剤として注目されているコンパクチン、メバロチンならびにプラバスタチンの活性部位であるラクトン部分に容易に変換できることが知られている。例えば、米国特許第4611067号明細書に記載されているように、(R) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エステルの水酸基をトリアルキルシリル基、テトラヒドロピラニル基などで保護した化合物を加水分解してアミドとし、酸処理することによって4-ヒドロキシ-3,4,5,6-テトラヒドロー2H-ピラン-2-オンへと導いている例がある。

ーナー(WittigーHornor)試薬とした後、数工程を経て 分子内にリン化合物を含むHMG-CoA還元酵素の阻 害剤へと導いている例がある。

2

【0004】更には、特許公表公報平3-502798 号に記載のように水酸基を保護した4-シアノ酪酸誘導体にマロン酸誘導体を反応させることにより6-シアノ-3-オキソヘキサン酸誘導体へと導き、コレステロール生合成阻害剤へと導いている。

【0006】また、プルテン・オブ・ケミカル・ソサイアティ・フランス(Bull. Chem. Soc. Fr.), 33巻, 732頁(1923年)には4-クロロー3-ヒドロキシブチロニトリルを加水分解してカルボン酸とした後に、このものをエチルエステル化したものにシアン化カリウムを作用させて4-シアノー3-ヒドロキシ酪酸エチルエステルを得る方法が記載されている。しかし、この文献の方法で収率が低く、光学活性についても全く触れられていない。

【0007】ところで、このHMG-CoA還元酵素の 阻害剤の活性はラクトン部分の水酸基の立体が重要な役 割を果たすことが知られている。例えば、ジャーナル・ オブ・メディシナル・ケミストリー(J. Med. Chem., 30巻、1863頁(1987年)) あるいはジャーナ ル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J. Org. Che m.) 51巻、4931頁、(1986年) などには水酸 40 基の位置による阻害活性の低下が記載されている。ま た、特開昭56-45470号公報および特開昭61-129178号公報には阻害活性を示すためにはコンパ クチンやメピノリンなどのラクトン環において4位の水 酸基の立体が(R)配置でなければならない旨の記載が あり、従来の合成法においては光学活性体の分離をしな ければならず、不要な異性体の生成を伴い工程も非常に 長いとの記載がある。また、特開昭61-282342 号公報にも同様の記載があり、有用な阻害活性を示すた めには、ラクトン環の前駆体であるジヒドロキシカルボ

(3S) と (5R) でなければならない旨の記載があ る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】以上のような報告例が あるが、阻害活性の高いラクトン環部位を得るためには 従来の反応では水酸基の保護が必要であったり、光学活 性体の分離を行ったりしなければならず、工程も非常に 長いものであった。したがって反応工程も短く操作が簡 便な経済的な合成方法が望まれていた。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前配課題を 解決すべく種々検討した結果、ジケテンから得られる 4 - ハロゲノアセト酢酸 t - プチルエステルに不斉水案化 反応を行うことにより、容易に得られる(S)-(-) -4-ハロゲノ-3-ヒドロキシ酪酸 t -プチルエステ ルにシアノ化反応を行うことによって簡便に医薬中間体 として有用な(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロ キシ酪酸 t - プチルエステルを得ることを見出し本発明 の完成に至った。

【0010】 すなわち、本発明は式(1) 【化4】

(式中Bu-tはt-プチル基を示す。) で表される (R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキシ酪酸 t -ブチルエステルに関する。

【0011】又本発明は一般式(2)

【化5】

(式中Xは塩素原子又は臭素原子を示し、Bu-tはt -プチル基を示す。) で表される(S) - (-) - 4-ハロゲノ-3-ヒドロキシ酪酸 t-プチルエステルに一 般式 (3)

(式中Mはナトリウム原子あるいはカリウム原子を示 す。)で表されるシアン化物を反応せしめることにより 式(1)

【化7】

$$NC \longrightarrow OB n - 1$$
 (1)

で表される(R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキ シ酪酸 t - プチルエステルを製造する方法に関する。

【0012】本発明の原料である4-ハロゲノアセト酢 酸tープチルエステルは例えば特開昭61-14619 1号公報記載の方法により容易にジケテンから得られる ものである。また、光学活性な(S)-(-)-4-ハ 50 L-6000(日立製作所(株)製)

ロゲノー3-ヒドロキシ酪酸t-プチルエステルを得る 方法としては、特開平1-211551号公報記載の方 法により4-ハロゲノアセト酢酸エステル類をルテニウ ムー光学活性ホスフィン錯体、例えばRu2 Cl4 (B INAP) 2 (C2 H5) 3 N (BINAP 12, 2' -ピス(ジフェニルホスフィノ) -1, 1´-ピナフチ ルを示す〕を触媒として用い不斉水素化を行うことによ って得られるものである。この反応において、ルテニウ ム光学活性ホスフィンの配位子であるBINAPとして 10 は (R) - (+) - BINAPを用いることにより (S) 体の化合物が得られる。また、特開昭 6 1-14 6191号公報記載のように4-ハロゲノアセト酢酸エ ステルを微生物発酵により光学活性(S)-(-)-4 - ハロゲノ-3-ヒドロキシ酪酸 t - プチルエステルを 得ることもできる。

【0013】次にシアノ化の工程は、不斉水素化によっ て得られた(S)-(-)-4-ハロゲノ-3-ヒドロ キシ酪酸 t - プチルエステルをジメチルホルムアミド、 アセトニトリル、ジメチルスルホキシドのような非プロ 20 トン性極性溶媒に溶かし、これに一般式(3)で表され るシアン化物の水溶液を加え、反応温度15℃~100 ℃好ましくは40~70℃の反応時間で2時間から5時 間、好ましくは2時間から3時間攪拌することによって 行なわれる。このようにして合成された化合物(1)は 反応液を酢酸エチル、トルエン、ジイソプロピルエーテ ル、塩化メチレンなどの有機溶媒で抽出した後に水洗 し、溶媒を留去し、得られた残渣をトルエン、酢酸エチ ル、エタノール、イソプロピルエーテルなどで再結晶す ることによって得られる。

【0014】本発明の有利な点の一つに式(1)で表さ れる本発明化合物の高い光学純度という点がある。例え ば、他の低級エステル(エチル、プロピル、n-プチル などのエステル)はそのものが液状であるために光学純 度を上げる簡単な手段はないが、本発明化合物は結晶で あるために他のエステルには適用できない再結晶によ り、光学純度を上げる操作ができる。この事実は本発明 によって初めて知得されるものである。また、他の有利 な点はシアノ化反応の際に他の低級エステルでは、けん 化が起こり収率が低下するが、本化合物の場合はけん化 40 が起こりにくいため収率も余り低下しない。

[0015]

【実施例】次に実施例により本発明を詳細に説明する が、本発明はこれら実施例によって限定されるものでは ない。なお、以下の測定には次の装置を用いた。

¹H-NMR:AMX-400 (400MHz) (プル ッカー社製)

内部標準物質:テトラメチルシラン

旋光度:DIP-360(日本分光工業(株)製) 光学純度および化学純度:高速液体クロマトグラフィー 5

検出器: UV検出器L-4000UV (日立製作所 (株) 製)

赤外吸収スペクトル:IR-810(日本分光工業 (株) 製)

ただし、〔R〕が多い場合の式。

【0016】実施例1

(1) (S) - (-) - 4 - クロロ-3 - ヒドロキシ酪 酸 t ープチルエステルの製造法

あらかじめ窒素置換した100mlオートクレープ (ハス 10 z), 4.21 (1H, m) テロイ製) に、4 - クロロアセト酢酸 t - プチルエステ ル58.35g(0.3mol)とt-ブチルアルコール 120mlを加え、ここにRu₂ Cl₄ ((R) - (+) -BINAP) 2 Et 3 N 250mg (0. 00015 mol) の塩化メチレン 2 ml 溶液を加え、水素圧 10~1 5 kg/cm²、反応温度100℃で2時間攪拌して水素化 を行った。溶媒を留去して残渣を減圧蒸留して、無色透 明液状の(S)- (-) - 4-クロロ-3-ヒドロキシ 酪酸 t - プチルエステル53.0gを得た。収率90 %。光学純度92%ee。

【0017】融点:113~116℃/mmHg 旋光度〔α〕₂ 25 -94.7° (メタノール, C= 1.88)

IR (neat) ν_{max} (cm⁻¹): 3450, 2950, 1 730, 1630

 $^{1}H-NMR$ $\delta:1.47$ (9H, s), 2.55 (4H, m), 3. 42 (1H, brs), 3. 58 (2 H, m), 4. 22 (1H, m)

【0018】(2)(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 t ープチルエステルの製造法

(1) で得られた (S) - (-) - 4 - クロロ-3-ヒ ドロキシ酪酸 t - プチルエステル36.7g(0.22 mol) をジメチルスルホキシド120mlに溶かし、この 溶液に青酸ソーダ12.7g(0.25mol)を含む水 溶液45mlを加え、65℃で3時間攪拌した。転化率は 100%であった。続いて反応液を酢酸エチル120回 で抽出し、得られた有機層を水洗後、無水硫酸マグネシ ウムで乾燥した。溶媒を留去した後、蒸留し、(R)-(-) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 t-プチルエ ステルの粗生成物22.6gを得た。収率65%、光学 40 純度92%。

沸点:130~135℃/0.2mmEg

続いてこの粗生成物を80mlのトルエンにより再結晶し て(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 t -プチルエステル15.8gを得た。粗生成物からの収 率70%。光学純度99%ee以上。

【0019】融点:63~64℃

旋光度〔α〕₁ ²⁵ -2.09° (メタノール, C= 1. 05)

IR (KBr) ν_{max} (cm⁻¹): 3450, 2950, 22 50 IR (neat) ν_{max} (cm⁻¹): 3450, 2950, 2

*融点:ミクロ融点測定器(柳本製作所(株)製) 光学活性な両鏡像体 (enantiomer) の (R) と (S) のどちらがどのくらい多く存在するかを%表示した光学 純度の表示法は次式による。

 $\%ee = \{ ((R) - (S)) / ((R) + (S)) \} \times 100$

60, 1730, 1630, 1190

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1. 46 (9 H. s), 2. 55 (2 H, m), 3. 45 (1 H, brs), 3. 59 (2 H, dd, J = 1. 2 Hz, 5. 6 H

【0020】比較例1

(R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキシ酪酸 n -プチルエステルの製造方法

あらかじめ窒素置換した100mlオートクレープ (ハス テロイ製) に、4-クロローアセト酢酸 η - プチルエス テル38.8g(0.2mol)とn-プチルアルコール 50mlを加え、ここにRu₂ Cl₂ ((R) - (+) -BINAP] 2Et 3 N 73mgの塩化メチレン2ml溶 液を加え、水素圧11~12kg/cm²、反応温度100 20 ℃で2時間攪拌して水素化を行った。溶媒を留去した 後、残渣を減圧蒸留して(S)-(-)-4-クロロー 3-ヒドロキシ酪酸n-ブチルエステル35.0gを得 た。 収率90%。 光学純度94%ee.

【0021】融点:118~120℃/2mmHg 旋光度〔α〕。²⁵ -14.1° (クロロホルム, C= 1)

IR (neat) ν_{max} (cm⁻¹): 3450, 2950, 1 730, 1630

 $^{1}H-NMR$ $\delta:0.94$ (3H, t, J=7.3H 30 z), 1. 39 (2 H, m), 1. 62 (2 H, m), 2. 63 (4H, m), 4. 14 (2H, t, J=6. 7Hz), 4. 35 (1H, m)

【0022】引き続き、得られた(S)-(-)-4-クロロー3-ヒドロキシ酪酸n-プチルエステルを実施 例1と同様の方法により(R)-(-)-4-シアノー 3-ヒドロキシ酪酸 n-プチルエステルへと導いた。す なわち、(S) - (-) -4-クロロ-3-ヒドロキシ 酪酸n-プチルエステル58.5g(0.3mol)をジ メチルスルホキシド180mlに溶かしこの溶液に青酸ソ ーダ16.7g(0.34mol)を含む水溶液67.5 ml中に加え、65℃で2時間攪拌した。反応液を酢酸工 チルで抽出し、得られた有機層を水洗した後に、硫酸マ グネシウムで乾燥した。溶媒を留去した後、蒸留し (R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキシ酪酸n -プチルエステルを得た。 収率58%。 光学純度94

【0023】沸点:125℃/0.5mmHg 旋光度〔α〕₁ ²⁵ -23.5° (クロロホルム, C= 1. 48)

7

260, 1730, 1630, 1190

¹ H-NMR (CDCl₃) δ:0.94 (3H, t, J=7.3Hz), 1.39 (2H, m), 1.62 (2H, m), 2.63 (4H, m), 4.14 (2H, t, J=6.7Hz), 4.35 (1H, m) [0024] 比較例 2

(R) - (-) - 4 - シアノ - 3 - ヒドロキシ酪酸エチ ルエステルの製造法

実施例1および比較例1と同様にして得られた(S) - (一) -4-クロロー3-ヒドロキシ酪酸エチルエステル(36.7g,0.22mol)をジメチルスルホキシド120mlに溶かし、ここへ青酸ソーダ(12.7g,0.25mol)の水溶液45mlを加える。続いて65℃に加熱し、2時間攪拌し反応を終了した。転化率90%。反応溶液を酢酸エチル120mlで抽出し、有機層を水400mlで洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥する。水層は酢酸エチル60mlで2回抽出し、有機層と合わせて乾燥する。溶媒留去した後、蒸留して(R) - (一) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エチルエステルを20g得た。 収率57.5%。 光学純度95.6%ee.

【0025】沸点:115℃/2mmIg

旋光度 (α) p 20 -27.0° (CHCl₃, C= 1.1)

IR (neat) ν_{max} (cm^{-1}): 3450, 2970, 2 260, 1730, 1630

 1 H - NMR δ (CDCl₈): 1. 29 (3H, t, J=7. 2Hz), 2. 63 (4H, brs), 3. 4 2 (1H, brs), 4. 20 (2H, q, J=7. 2H

z), 4.34 (1H, m) 【0026】比較例3

収率 56.5%。 光学純度 95% ee.

【0027】沸点:110℃/0.3mmHg

(-) -4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エチルエステ 10 旋光度 (α) p 25 -23.6° (CHCls, C= ν (36.7g, 0.22mol) をジメチルスルホキシ 1.1)

IR (neat) ν_{max} (cm^{-1}): 3450, 2950, 2 260, 1730, 1630, 1190

 1 H - NMR δ (CDC1₃): 0. 96 (3 H, t, J=7. 2Hz), 1. 68 (2H, d, d, q, J=0. 2, 6. 7, 7. 4Hz), 2. 62 (4 H, m), 4. 10 (2H, t, J=6. 7Hz), 4. 34 (1H, m)

[0028]

【発明の効果】本発明においてはジケテンより容易に得られる4ーハロゲノアセト酢酸 t ープチルエステルを不斉水素化して得られる(S) - (-) - 4-ハロゲノー3-ヒドロキシ酪酸 t ープチルエステルをシアン化物によりシアノ化することにより、高い光学純度の(R) - (-) - 4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 t ープチルエステルを得ることができる。本発明により経済的かつ工業的規模で光学活性な4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸t-プチルエステルを製造することが可能である。